### ⑩日本国特許庁(JP)

(1) 特許出願公開

## ⑩ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭61-5317

@Int\_Cl\_4

識別記号

庁内整理番号

母公開 昭和61年(1986)1月11日

G 05 D 3/12

7623-5H

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

50発明の名称

自動焦点合わせ装置

②特 顧 昭59-124821 顧昭59(1984)6月18日

70発明者

京都市右京区花園土堂町10番地 立石電機株式会社内

の出 関 立石電機株式会社 京都市右京区花園土堂町10番地

70代理 弁理士 岩倉 外1名

1.発明の名称

自動焦点合わせ装置

(1) レンズ系の鏡頭前方の焦点面に板状物体の 表面を一致させるように位置決めする自動焦点合

わせ装置であつて、上記板状物体の支持台を上記 レンズ系の光輪方向に密位させる新聞専用変化機

構と、この変位機構の可勤基合と上記支持台との 間において上記光軸の周辺の複数箇所に設けられ

上配可動差台と上記支持台との開展を微調整する

後数個の圧電アクチェータと、上記レンズ鏡頭前

婚商において上記圧電アクチェータに対応する複 数箇所に設けられ、この鏡腕前續面と上記板状物

体との間隔を非接触で測定する静電容量式の複数 個の機小変位センサと、各倣小変位センサの出力

に基づいてそれぞれに対応する上記各圧策アクチ エータを駆除する数器整用側御回路とを備えた自

動焦点合わせ装置。

3 . 発明の詳細な説明

(発明の技術分野)

この発明は、半導体製造に用いられるマスクア ライナーや、その他の光学式の測定および検査装 難における自動焦点合わせ装置に関する。

【母本技術とその気頭点】

半導体装置の製造に使用するマスクアライナー として、半導体ウェハ面にマスクバターンを投影 結集し、マスクとウエハを位置合わせした後、露 光するプロジェクジョンアライナーが知られてい

このプロジェクションアライナーにおいては、 微潮なマスクパターンをウエハ上に高精度に焼付 けるために、ウエハ表面をマスクパターンの結婚

面(以下、焦点面とする)に正確に位置合わせす

ることが重要である。

従来のプロジェクションアライナーにおいては、 レンズ鏡頭とウェハ表面の簸觴を光学センサやエ アマイクロセンサを用いて測定するとともに、ウ

エハを載覆したチヤツクの上下移動(レンズ系の

光軸方向の変位)をモータや空気圧を利用したア

クチェータによって行つていた(例えば特異的 56-2630号公報金照)。しかし、半導体レ - ザーやLEDなどによる光学.センサを用いた從 来の自動性点合わせ装置では、変位測定対象物で あるウェハ表面が一様な鏡面状態でないと正確な 変位測定が行えないという問題がある。実際のウ エハ表面は完全な表面状態ではなく、ある程度の 凹凸を含んである。そのためウェハの変位制定額 にパラツキが生じ、それが依置決め誤差となる。 また、空気流を利用してウェハの位置を罰定する エアマイクロセンサを用いた従来装置では、検出 系の応答速度が遅いという大きな欠点があつた。 また、ねじ送りなどの機械的な構成で高額度を実 現するには、極めて高度な技術が必要で高価なも のとなる。また、空気圧を利用したアクチェータ でウェハを変位させる機構では、エアマイクロセ ンサ以上にその応答性が悪い。

上述のような問題はプロジェクションアライナーだけの問題でなく、光学式の各種割定および検査数量においても同様である。

#### (発明の目的)

#### (発明の構成と効果)

各酸小変位センサの出力に基づいてそれぞれに対 応する上配各圧電アクチェータを駆動する機構整 用制御回路とを備えたことを特徴とする。

上記は、かまれば、かまない。 の構成したは、かれば、かり、 をり、 の構成したは、 の光光をできませる。 の光光をできませる。 の光光をできませる。 の光光をできませる。 の光光をできままる。 の光光をできまる。 の光光をできままる。 の光光をできまる。 の光光をできまる。 の表面のは、 ののは、 のった。 ののは、 ののは、 ののは、 ののは、 ののは、 のった。 ののは、 のので。 のの。 のので。 のので。 ののは、 のので。 のので。 のので。 のので。 のので。 のので。 のので。 のの

第1回は本発明による自動焦点合わせ装置を搭載したプロジェクションアライナーを示す。周囲 において、9は定盤、8は定盤9の水平面に搭載 された X Y ステージ8、7 は X Y ステージ8の可 動態に搭載された自転ステージ、6 は回転ステー ジ7の可動態に搭載された粗減整用上下変を観視。 5 は上下変を機構6 の可動態に固設された可動器 台である。また、 3 0 はレンズ 表観、 3 はレンズ 表記の中心に限されているレンズ系をそれ ぞれ示している。

可動基台5の上面に3個の圧電アクチェータ 1A.1B.1Cを介してウェハチャツク4がほ は平行に搭載されている。このウェハチャック4 レンズ底割30の範面部分には、レンズ系3を 取別改正三角形をなす位置に、3個の静電容量式 がか変位センサ2A、2日。20数付けられて いる。この様子を第2因かよび第3数に示してい る。センサ2Aは圧電アクチェータ1Aと対応し、セ センサ2Bは圧電アクチェータ1Bと対応し、セ ンサ2Cは圧電アクチェータ1C対応する。 第電等量式製小変位とフサ2A,2B、2Cは そのセンサ面がウェハ13表面に対向するように 最終的な位置使め時には圧電アクチェータ1A はセンサ2Aの出力に基づいて駆動され、圧電ア クチェータ1Bはセンサ2Bの出力に基づいて駅 動され、圧電アクチェータ1Cはセンサ2Cの助力に基づいて駅 動され、センサ2A・2B・2Cの の各点に切いてウェハ1Tとの関係がレンズ系3 の焦点距離に関係の影響される。この回廊 よその制度距離に服務系の1つを示している。この回廊

はセンサ2Aとアクチェータ1Aとの割につついて のものである。センサ2Aの出力は増幅器15で 増幅され、センサ2Aとウエハ11との剥削を は付施に対応した電圧Vdが出力される。この検動 を出て はくdとヲめ数定された基準値圧Voとが差勢。 に 機固器18の入力となり、この回路18の入力となる。

## 4. 逸面の描単な説明

1 A. 1 B. 1 C・圧電アクチエータ、2 A. 2 B. 2 C・非常容量式数小変位センサ、3・レンズ系、3 O・レンズ表展、4・・ウェハチャック
支持台)、5・・可断基台、6・・租票差上下変位機数、1 1・・ウェハ(複状物体)。

特許出願人 立石電機後式会社 代理人 弁理士 岩魚哲二 (他 1 名 )

# 特開昭61-5317(4)









